[19] Patents Registry
The Hong Kong Special Administrative Region
香港特別行政區
專利註冊處

[11] 1001101 A
EP 0671025 B1

[12] **STANDARD PATENT SPECIFICATION**
標準專利說明書

[21] Application No. 申請編號
98100206.3

[22] Date of filing 提交日期
10.01.98

[51] Int.Cl.[6] G03F

[30] Priority 優先權
25.11.92 US 982197

[45] Publication of the grant of the patent 批予專利的發表日期
22.05.98

EP Application No. & Date 歐洲專利申請編號及日期
EP 94901349.4 08.11.93

EP Publication No. 歐洲專利發表編號
EP 0671025

Publication date of EP grant of the patent 批予歐洲專利的發表日期
13.08.97

[86] International Application No. 國際申請編號
PCT/US93/10798

[87] International Publication No. 國際申請發表編號
WO 94/12912 (09.06.94)

[73] Proprietor 專利所有人
HOECHST CELANESE CORPORATION, Route 202-206 North, Somerville, N.J. 08876, United States of America 美利堅合眾國

[72] Inventor 發明人
RAHMAN, DALIL M.

[74] Agent and / or address for service 代理人及/或送達地址
Deacons Graham & James, 3/Fl., Alexandra House, Central, Hong Kong
的近律師行，香港中環歷山大廈 3 樓

[54] METAL ION REDUCTION IN BOTTOM ANTI-REFLECTIVE COATINGS FOR PHOTORESISTS 光敏抗蝕劑底層反射塗層中的金屬雜子還原法